

談 話 室

第 12 回表面科学講演大会

高 須 芳 雄

信州大学繊維学部精密素材工学科
〒386 上田市常田 3-15-1

(1993 年 5 月 6 日受理)

The 12th Conference on Surface Science

Yoshio TAKASU

Department of Fine Materials Engineering,
Faculty of Textile Science and Technology,
Shinshu University, 3-15-1 Tokida, Ueda,
Nagano 386

(Received May 6, 1993)

日本表面科学会主催の第 12 回表面科学講演大会は、平成 4 年 12 月 15 日～17 日の 3 日間、前回と同じ早稲田大学総合学術情報センター国際会議場において開催されました。講演件数は一般講演 117 件、依頼講演 2 件、シンポジウム講演 8 件の合せて 127 件で大会参加者は 271 名（会員 192 名、学生 69 名、一般 10 名）といずれも前回より約 2 割ほど増加しました。講演分野をセッション別にみると、表面分析法・評価 26 件、表面化学 19 件、表面物理 13 件、薄膜 14 件、STM・AFM 11 件、半導体 12 件、表面処理 7 件、超伝導体 6 件、イオン・電子と表面 6 件、ならびに微粒子 5 件となっております。

シンポジウムは「イオン散乱—表面原子配列の高精度解析と半導体技術への応用」のテーマで 2 日目の午後に関かれ、活発な議論が展開されました。このテーマは最近 10 年ほどの間に急速に発展してきた分野を対象としており、シンポジウムでは、高速から低速の各種イオン散乱法を、Si デバイスの基本要素と化合物半導体の MBE 成長過程における“その場観察法”に適用した研

究紹介がなされました。

地域別の発表者をみると、東北・北海道 6 % (7)、関東 71 % (74)、中部 6 % (6)、関西 13 % (12)、九州・四国 4 % (2)と、昨年度とほぼ同じ割合でした（括弧内は昨年度の値）。関東地区の発表者の割合が依然多いのですが、関東以外の地域で講演大会を開催すればこの割合は変化するものと思われます。企画委員会などでは講演大会の年 2 回開催（うち 1 回は関東以外を検討）の可能性が慎重に検討されましたが、時期早尚との結論となりました。関西支部と中部支部の発足ともあいまって関東地区以外での学会活動が活発化しております。これから支部活動の発展により、一日も早く講演大会の年 2 回開催が実現することを期待するのは私だけではないでしょう。

講演大会では平成 4 年度の論文賞受賞者を代表して、廣田幸弘氏（NTT）に「超音波—超純水洗浄による低欠陥・清浄 GaAs 表面の形成」、奨励賞受賞者の田中英行氏（松下技研）に「Si(111)7×7 ドメイン境界とジグザグステップ」と題した記念講演を、それぞれのセッションで行っていただきました。従来は表彰式を懇親会会場で行っていましたが、今回はシンポジウム開催に先立ち、井深記念ホールにて行い、多数の出席者から盛大な拍手が送られていました。

第 13 回講演大会は、平成 5 年 11 月 30 日（火）～12 月 2 日（木）の 3 日間、同じ早稲田大学国際会場にて開催されます。講演申込締切り日は 9 月 1 日ですので、お近くの方にも声をかけていただき、ぜひともご参加くださいますようお願いいたします。なお、申込後に講演題目および発表者の変更が多数あり、講演要旨集を製作する際に時間がかかるうえに余分の経費がかっております。今年度からは何とぞそのようなことのないようよろしくお願い申し上げます。

なお、早稲田大学からは、広い新設の会場を無料でご提供いただいたうえに、運営上の援助も賜りました。末筆ながら記して感謝申し上げます。